- 1、硅突变结二极管的掺杂浓度为: $N_D=1 \times 10^{15}$ cm⁻³,
- N_A=1×10¹⁸cm⁻³。在室温下计算: (1) 内建电势差;
 - (2) 耗尽层宽度; (3) 零偏下最大内建电场。

(1)
$$V_D = \frac{kT}{q} ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0.0259 ln \frac{10^{15} \times 10^{18}}{(1.02 \times 10^{10})^2} =$$

0.774V; 带入0.026结果0.777V。

(2)
$$X_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s V_D}{qN_D}} = \sqrt{\frac{2\times 11.9 \times 8.854 \times 10^{-14} \times 0.777}{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{15}}} =$$

 $1.01 \times 10^{-4} cm$;

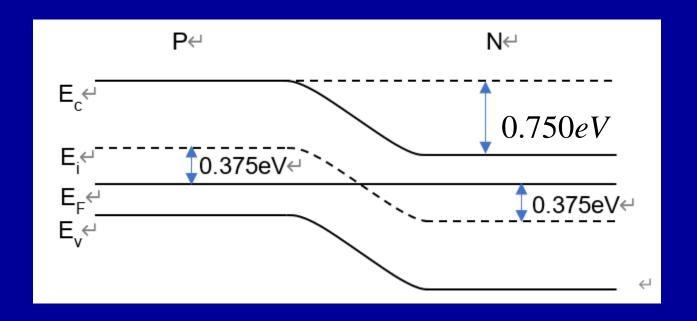
(3)
$$E_{max} = -\frac{qN_Dx_n}{\varepsilon_s} = -\frac{1.6 \times 10^{-19} \times 10^{15} \times 1.01 \times 10^{-4}}{11.9 \times 8.854 \times 10^{-14}} =$$

 $-1.53 \times 10^4 V/cm$;

- 2、考虑掺杂浓度为 $N_D=N_A=2\times10^{16}cm^{-3}$ 的硅突变PN结, T=300K, 1) 计算中性区内 P 区与 N 区费米能级的位置; 内建电势 Vbi; 结两侧空间电荷区宽度 x_n , x_p (2) 画出 PN 结平衡能带图并标注(1)中计算结果。
 - (1) 在n区有: $E_F E_{Fi} = kT ln \left(\frac{N_D}{n_i} \right) = 0.0259 ln \left(\frac{2 \times 10^{16}}{1.02 \times 10^{10}} \right) = 0.375 eV$, p区同理, $E_F E_{Fi} = -0.375 eV$; (2) $V_D = 0.375 + 0.375 = 0.750 eV$;

$$(3)x_{n} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{s}V_{D}}{q} \frac{N_{A}}{N_{D}(N_{A}+N_{D})}} = \sqrt{\frac{2\times11.9\times8.854\times10^{-14}\times0.750}{1.6\times10^{-19}} \frac{2\times10^{16}}{2\times10^{16}\times4\times10^{16}}} = 0.157 \,\mu m$$

同理,
$$x_p = 0.157 \mu m$$



3、计算零偏和施加反偏电压时,pn 结中的空间电荷区宽度变化了多少? T=300K 时,硅 pn 结的掺杂浓度为 N_A =10¹⁶ cm⁻³, N_D =10¹⁵ cm⁻³。假定 n_i =1.5×10¹⁰ cm⁻³, V_R =5 V。

$$V_D = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) = 0.026 \ln\frac{10^{16} \times 10^{15}}{\left(1.5 \times 10^{10}\right)^2} = 0.637V$$

$$x = \sqrt{\frac{2V_D \varepsilon_s}{q} \frac{N_A + N_D}{N_A \times N_D}} = 0.961 \times 10^{-4} cm$$

$$x' = \sqrt{\frac{2(V_D + V_R)\varepsilon_s}{q} \frac{N_A + N_D}{N_A \times N_D}} = 2.86 \times 10^{-4} cm$$

$$\Delta x = x' - x = 1.90 \times 10^{-4} cm$$

4、T=300K时,GaAs反偏pn结的最大电场为 $|E_{max}| = 2.5 \times 10^5 \text{V/cm}$,掺杂浓度为 $N_A = 8 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$, $N_D = 5 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$ 。确定产生这个最大电场的反偏电压的大小。

$$V_D = \frac{kT}{q} ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0.0259 ln \frac{5 \times 10^{15} \times 8 \times 10^{15}}{(2.1 \times 10^6)^2} = 1.13V;$$

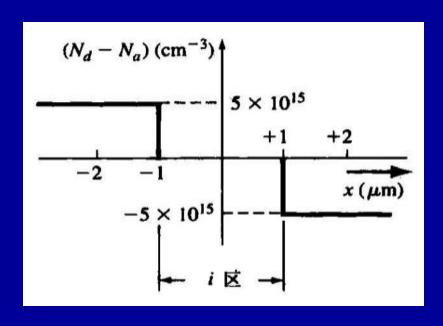
$$|E_{max}| = \frac{q N_D x_n}{\varepsilon_S}, \quad \exists x_n = \frac{|E_{max}| \varepsilon_S}{q N_D} = \frac{2.5 \times 10^5 \times 13.1 \times 8.854 \times 10^{-14}}{1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{15}} = 3.625 \times 10^{-4} cm;$$

4、T=300K时,GaAs反偏pn结的最大电场为 | E_{max} | =2.5×10⁵V/cm, 掺杂浓度为N_A=8×10¹⁵cm⁻³, N_D=5×10¹⁵cm⁻³。确定产生这个最大电场的反偏电压的 大小。

由
$$x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s(V_D + V_R)}{q} \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)}}$$
,

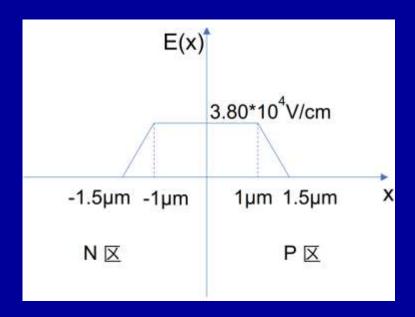
得: $V_R = \frac{qx_n^2}{2\varepsilon_s} \frac{N_D(N_A + N_D)}{N_A} - V_D = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times (3.625 \times 10^{-4})^2}{2 \times 13.1 \times 8.854 \times 10^{-14}} \frac{5 \times 10^{15} \times (5 \times 10^{15} + 8 \times 10^{15})}{8 \times 10^{15}} - 1.13 = 72.5V_0$

5、硅PIN结的掺杂曲线如图,"I"对应着理想本征区。 本征区内没有杂质掺杂。给PIN结外加一个反偏电场, 以使空间电荷区占据从-1.5μm到1.5μm的所有区域。 (1)采用泊松方程计算出x=0处的电场,(2)画出PIN结电 场随距离变化的曲线,(3)计算出外加反偏电压的大小。



(1)
$$\frac{d^2\varphi_i}{dx^2} = -\frac{\rho(x)}{\varepsilon_S} = -\frac{dE}{dx}$$

当-1.5 < x < -1 μ m时, $\rho(x) = qN_D$, $\frac{dE}{dx} = \frac{qN_D}{\varepsilon_S}$ 有: $E = \frac{qN_Dx}{\varepsilon_S} + C_1$ 。
因为 $x = -x_1 = -1.5\mu$ m时, $E = 0$,得 $C_1 = \frac{qN_Dx_1}{\varepsilon_S}$,所以 $E = \frac{qN_D}{\varepsilon_S}(x + x_1)$ 。
当-1 < x < 1 μ m时, $\rho(x) = 0$, $\frac{dE}{dx} = 0$,有: $E = E(-1)$ 。
所以 $E(0) = E(-1) = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{15}}{11.9 \times 8.854 \times 10^{-14}}(-1 + 1.5) \times 10^{-4} = 3.80 \times 10^4 V/cm$ 。



(3) 和pn结结构相比,掺杂浓度不变,所以零偏内建电势保持不变。

$$V_{D0} = \frac{kT}{q} ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0.0259 ln \frac{5 \times 10^{15} \times 5 \times 10^{15}}{(1.5 \times 10^{10})^2} = 0.659 V$$
,可得 $V_R = (2+3) \times 10^{-4} \times 3.80 \times 10^4 \div 2 - 0.659 = 8.84 V$ 。

6、考虑T=300K时的均匀掺杂GaAs PN结,其N区的 E_{F} - E_{F} =0.365eV,P区的 E_{F} - E_{F} =0.330eV, α =5.4×10⁻⁴ eV/K, β = 204 K, T=300K 时ni 为 1×10⁷cm⁻³ 。杂质完全电离, E_{g} (0) =1.519 eV,请参考以下两式:

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{T - \beta}$$

$$n_{i} = N_{C} \exp\left(-\frac{E_{C} - E_{i}}{kT}\right) = N_{V} \exp\left(-\frac{E_{i} - E_{V}}{kT}\right)$$

$$= \sqrt{N_{C}N_{V}} \exp\left(-\frac{E_{g}}{2kT}\right)$$

$$= 4.9 \times 10^{15} \left(\frac{m_{de}m_{dh}}{m_{0}^{2}}\right)^{3/4} M_{C}^{1/2} T^{3/2} \exp\left(-\frac{E_{g}}{2kT}\right)$$
(28)

画出T=400 K时该pn结的能带图,标注费米能级的位置。 给出计算过程。

(2)
$$N_D = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_{Fi}}{kT}\right) = 10^7 \exp\left(\frac{0.365}{0.026}\right) = 3.42 \times 10^{13} cm^{-3}$$

$$N_A = n_i \exp\left(\frac{E_{Fi} - E_F}{kT}\right) = 10^7 \exp\left(\frac{0.330}{0.026}\right) = 1.32 \times 10^{12} cm^{-3}$$

$$E_g(300) = E_g(0) - \frac{5.4 \times 10^{-4} \times 300^2}{300 - 204} = 1.01 \, eV$$

$$E_g(400) = E_g(0) - \frac{5.4 \times 10^{-4} \times 400^2}{400 - 204} = 1.08 \ eV$$

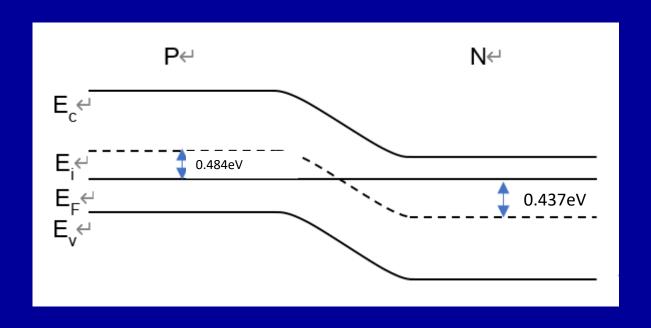
$$n_{i} = N_{C} \exp\left(-\frac{E_{C} - E_{i}}{kT}\right) = N_{V} \exp\left(-\frac{E_{i} - E_{V}}{kT}\right)$$

$$= \sqrt{N_{C}N_{V}} \exp\left(-\frac{E_{g}}{2kT}\right)$$

$$= 4.9 \times 10^{15} \left(\frac{m_{de}m_{dh}}{m_{0}^{2}}\right)^{3/4} M_{C}^{1/2} \Gamma^{3/2} \exp\left(-\frac{E_{g}}{2kT}\right)$$

$$n_i(400) = n_i(300) \times (\frac{400}{300})^{1.5} \exp(\frac{2k \cdot 300}{1.01} - \frac{2k \cdot 400}{1.08}) = 1.15 \times 10^7 \, cm^{-3}$$

$$n: E_F - E_i = \frac{kT}{q} \ln(\frac{N_D}{n_i}) = 0.484eV$$
 $p: -(E_F - E_i) = \frac{kT}{q} \ln(\frac{N_A}{n_i}) = 0.437eV$



1、施加正向偏压时,求PN结空间电荷区边缘处的少子 空穴浓度。T=300K,掺杂浓度为N_A=6×10¹⁵cm⁻³, N_D=10¹⁶cm⁻³, 正偏电压为V_f=0.6V。假定 $n_i = 1.02 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$

由结定律知:

$$n(-x_p) = n_{p0} \exp(\frac{qV_f}{kT})$$

$$n(-x_p) = n_{p_0} \exp(\frac{qV_f}{kT})$$
 $p(x_n) = p_{n_0} \exp(\frac{qV_f}{kT})$

热平衡下少子空穴浓度为

$$n_{p0} = n_i^2 / N_A = (1.02 \times 10^{10})^2 / (6 \times 10^{15}) = 1.73 \times 10^4 \text{cm}^{-3}$$

 $p_{n0} = n_i^2 / N_D = (1.02 \times 10^{10})^2 / 10^{16} = 1.04 \times 10^4 \text{cm}^{-3}$

∴代入结定律,则有

$$n(-x_p)=1.73 \times 10^4 \exp(0.6/0.0259)=1.99 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$$

 $p(x_n)=1.04 \times 10^4 \exp(0.6/0.0259)=1.20 \times 10^{14} \text{cm}^{-3}$

2、GaAs PN结的掺杂浓度为N_△=4×10¹⁶cm⁻³, N_D=2×10¹⁷cm⁻³, 结面积为A=10⁻³cm², 外加正偏电压 V=1.5V。 设 $n_i=1.8\times10^6$ cm⁻³, $D_n=205$ cm²/s, $D_p=9.8$ cm²/s τ_{n0} =5×10-8s, τ_{p0} =10-8s。 计算 (1) 空间电荷区边缘的 少子电子扩散电流; (2) 空间电荷区边缘的少子空穴 扩散电流; (3) PN结二极管的总电流。

(1)
$$J_n(-x_p) = \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} \exp\left(\frac{qV}{kT}\right) = \frac{qn_i^2}{N_A} \sqrt{\frac{D_n}{\tau_{n0}}} \exp\left(\frac{qV}{kT}\right)$$

$$= \frac{(1.6 \times 10^{-19})(1.8 \times 10^{6})^{2}}{4 \times 10^{16}} \sqrt{\frac{205}{5 \times 10^{-8}}} \times \exp\left(\frac{1.5}{0.0259}\right) = 1.18 \times 10^{-7} \text{ A. } 4 \times 10^{-2}$$

 $10^{7} A/cm^{2}$,

$$I_n = AJ_n(-x_p) = 10^{-3} \times 1.18 \times 10^7 A/cm^2 = 1.18 \times 10^4 A;$$

(2)
$$J_p(x_n) = \frac{qD_p p_{n0}}{L_p} \exp\left(\frac{qV}{kT}\right) = \frac{qn_i^2}{N_D} \sqrt{\frac{D_p}{\tau_{p0}}} \exp\left(\frac{qV}{kT}\right)$$

$$= \frac{(1.6 \times 10^{-19})(1.8 \times 10^{6})^{2}}{2 \times 10^{17}} \sqrt{\frac{9.8}{10^{-8}}} \times \exp\left(\frac{1.5}{0.0259}\right) = 1.15 \times$$

 $10^6 A/cm^2$,

$$I_p = AJ_p(x_n) = 10^{-3} \times 1.15 \times 10^6 A/cm^2 = 1.15 \times 10^3 A$$
:

(3)
$$I = I_n + I_p = 1.18 \times 10^4 + 1.15 \times 10^3 = 1.29 \times 10^4 A$$

16

3、理想硅PN结的掺杂浓度为 $N_D=3\times10^{16}cm^{-3}$, $N_A=2.5\times10^{16}cm^{-3}$, 结的横截面积为 $A=4\times10^{-4}cm^2$ 。 $D_n=25cm^2/s$, $D_p=10cm^2/s$, $\tau_{n0}=2\times10^{-7}s$, $\tau_{p0}=8\times10^{-8}s$ 。 设 $n_i=1.5\times10^{10}cm^{-3}$ 。计算(1)空穴形成的理想反向饱和电流; (2)电子形成的理想反向饱和电流; (3)外加正偏压 $V_a=0.6V_{bi}$ 时, x_n 处的空穴浓度; (4)外加正偏压 $V_a=0.8V_{bi}$ 时, x_n 处的电子浓度。

(1)
$$I_{sp} = A\left(\frac{qD_{p}p_{n0}}{L_{p}}\right) = Aq\sqrt{\frac{D_{p}}{\tau_{p0}}} \frac{n_{i}^{2}}{N_{D}}$$

$$= 4 \times 10^{-4} \times 1.6 \times 10^{-19} \sqrt{\frac{10}{8 \times 10^{-8}}} \frac{(1.5 \times 10^{10})^2}{3 \times 10^{16}} = 5.37 \times 10^{-15} A;$$

(2)
$$I_{sn} = A\left(\frac{qD_{n}n_{p0}}{L_{n}}\right) = Aq\sqrt{\frac{D_{n}}{\tau_{n0}}} \frac{n_{i}^{2}}{N_{A}}$$

 $= 4 \times 10^{-4} \times 1.6 \times 10^{-19} \sqrt{\frac{25}{2 \times 10^{-7}}} \frac{(1.5 \times 10^{10})^{2}}{2.5 \times 10^{16}} =$
 $6.44 \times 10^{-15}A$;
(3) $V_{D} = \frac{kT}{q} ln\left(\frac{N_{A}N_{D}}{n_{i}^{2}}\right) = 0.0259 ln\frac{3 \times 10^{16} \times 2.5 \times 10^{16}}{(1.5 \times 10^{10})^{2}} =$
 $0.746826V$,
 $V_{a} = 0.6V_{D} = 0.6 \times 0.746826 = 0.44810V$,
 $p_{n}(x_{n}) = p_{n0} \exp\left(\frac{qV_{a}}{kT}\right) = \frac{n_{i}^{2}}{N_{D}} \exp\left(\frac{qV_{a}}{kT}\right) =$
 $\frac{(1.5 \times 10^{10})^{2}}{3 \times 10^{16}} \exp\left(\frac{0.44810}{0.0259}\right) = 2.45 \times 10^{11} cm^{-3}$;
 $(4) n_{n}(x_{n}) = N_{D} = 3.00 \times 10^{16} cm^{-3}$

第二次作业

4、理想的 p+n 结为 T=300 K 时均匀掺杂的冶金结。掺杂浓度的关系为 N_A=40N_D。内建电势差为 V_D=0.69 V。反偏电压 V_R=5 V。设 n_i =1.5×10¹⁰ cm⁻³, ϵ_r =11.9。计算: (1) N_A、N_D; (2) x_p、x_n; (3) |E_{max}|; (4) C'(单位面积的势垒电容)。

$$V_D = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

$$0.69 = 0.0259 \ln \frac{40 N_D^2}{n_i^2} = 0.0259 (\ln 40 + 2 \ln \frac{N_D}{n_i})$$

$$N_D = 1.45 \times 10^{15} cm^{-3} \qquad N_A = 5.78 \times 10^{16} cm^{-3}$$

4、理想的 p+n 结为 T=300 K 时均匀掺杂的冶金结。掺杂浓度的关系为 N_A=40N_D。内建电势差为 V_D=0.69 V。反偏电压 V_R=5 V。设 n_i =1.5×10¹⁰ cm⁻³, ϵ_r =11.9。计算: (1) N_A、N_D; (2) x_p、x_n; (3) |E_{max}|; (4) C'(单位面积的势垒电容)。

$$x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s(V_D + V_R)}{q} \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)}} = 2.31 \mu m$$

$$x_p = \frac{x_n}{40} = 0.058 \,\mu m$$

$$|E_{max}| = \frac{qN_Dx_n}{\varepsilon_S} = 4.82 \times 10^4 V / cm$$

$$C' = \frac{\mathcal{E}_r \mathcal{E}_0}{x_n + x_p} = 4.43 \times 10^{-5} F / m^2$$

5、考虑反偏电压8V时的硅p+n结。(1) 当P区掺杂浓度变为原来的四倍时,求内建电势差的变化量;(2) 当P区掺杂浓度由Na变为4Na时,求势垒电容的变化比率。

(1)
$$V_D = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$
,
所以 $V_D(4N_A) - V_D(N_A) = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{4N_A N_D}{n_i^2} \right) - \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = \frac{kT}{q} \ln(4) = 0.0359V$;

(2) 因为p±n结,所以几乎不变

6、反偏电压V_R=1V, T=300K时, GaAs PN结的总势垒 电容为1.2pF。其中一侧的掺杂浓度为5×10¹⁶cm⁻³,内建 电势差 $V_D=1.2V$ 。设 $n_i=1.8\times10^6$ cm⁻³, $\epsilon_r=13.1$ 。(1)计 算另一侧的掺杂浓度; (2) 结的横截面积; (3) 当结 电容变为0.8pF时的反偏电压V_R。

$$(1) V_D = \frac{kT}{q} ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0.0259 ln \left[\frac{5 \times 10^{16} N_D}{(1.8 \times 10^6)^2} \right] = 1.20,$$

解得: $N_D = 8.58 \times 10^{15} cm^{-3}$;

(2)
$$C = AC' = A\sqrt{\frac{q\varepsilon_s N_A N_D}{2(V_D + V_R)(N_A + N_D)}}$$

$$= A \sqrt{\frac{1.6 \times 10^{-19} \times 13.1 \times 8.854 \times 10^{-14}}{2 \times (1.20 + 1)}} \frac{5 \times 10^{16} \times 8.58 \times 10^{15}}{5 \times 10^{16} + 8.58 \times 10^{15}} = 1.2 \times 10^{-12},$$

解得:
$$A = 6.83 \times 10^{-5} cm^2$$
;

(3)
$$C = AC' = A \sqrt{\frac{q \varepsilon_s N_A N_D}{2(V_D + V_R)(N_A + N_D)}}$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \frac{1.2}{0.8} = \sqrt{\frac{V_D + V_{R1}}{V_D + V_{R2}}} = \sqrt{\frac{1 + 1.2}{1 + V_{R2}}}$$

1、突变硅p+n结中n区的掺杂浓度为 $N_d=4\times10^{15}$ cm⁻³

。当雪崩击穿发生时,不让耗尽区到达欧姆接触(穿

通)的最小n区长度是多少?

读图得:
$$V_B \approx 100V$$
,
$$x_n \approx \sqrt{\frac{2\varepsilon_s V_B}{qN_D}} = \sqrt{\frac{2\times 11.9\times 8.854\times 10^{-14}\times 100}{1.6\times 10^{-19}\times 4\times 10^{15}}} =$$

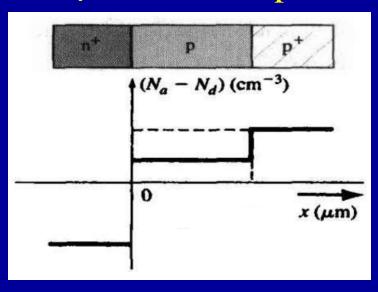
$$5.69 \times 10^{-4} \ cm_{\odot}$$

2、硅pn结的掺杂浓度为 $N_d=N_a=5\times 10^{18} cm^{-3}$ 。发生齐纳击穿时的临界电场为 $10^6 V/cm$ 。设 $n_i=1.5\times 10^{10} cm^{-3}$, $\epsilon_r=11.9$ 。求击穿电压的值(不忽略内建电势)。

 $V_B = 60(E_a/1.1)^{3/2} (N_B/10^{16})^{-3/4}$

$$V_D = \frac{kT}{q} ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) =$$
 $0.0259 ln \left[\frac{5 \times 10^{18} \times 5 \times 10^{18}}{(1.5 \times 10^{10})^2} \right] = 1.017V$,
由 $|E_{max}| = \frac{qN_D x_n}{\varepsilon_s}$, $有 10^6 = \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 5 \times 10^{18} x_n}{11.9 \times 8.854 \times 10^{-14}}$,
解得: $x_n = 1.317 \times 10^{-6} cm$,
又因为: $x_n = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s(V_D + V_R)}{q} \frac{N_A}{N_D(N_A + N_D)}}$,
有: $1.317 \times 10^{-6} =$
 $\sqrt{\frac{2 \times 11.9 \times 8.854 \times 10^{-14} \times (1.017 + V_R)}{1.6 \times 10^{-19}} \frac{1}{2 \times 5 \times 10^{18}}}$,

3、二极管的掺杂曲线经常如图所示,即所谓的n+pp+二极管。反偏时,耗尽区必须处于p区内,以防止过早的击穿。p区的掺杂浓度为2×1015cm-3。εr=11.9。计算使耗尽区处于p区内并且不发生击穿的反偏电压,假设p区长度为(a)75μm、(b)150μm。确定每种情况下,是耗尽区最大宽度先产生还是击穿先产生(忽略内建电势)?(可以当成n+p结构考虑)



(1)
$$x_p \approx \sqrt{\frac{2\varepsilon_s(V_R + V_D)}{qN_A}}$$
,

有: 75 × 10⁻⁴ =
$$\sqrt{\frac{2 \times 11.9 \times 8.854 \times 10^{-14} \times V_R}{1.6 \times 10^{-19}}} \frac{1}{2 \times 10^{15}}$$

解得: $V_R = 8.54 \times 10^3 V$

读图, 击穿电压在180V左右, 所以先击穿。

(2)
$$150 \times 10^{-4} = \sqrt{\frac{2 \times 11.9 \times 8.854 \times 10^{-14} \times V_R}{1.6 \times 10^{-19}}} \frac{1}{2 \times 10^{15}}$$
, 解得: $V_R = 1.71 \times 10^4 V$,先击穿。